

## บทที่ 3

### วิธีการวิจัย

#### 3.1 สารเคมี

- 3.1.1 เหล็กออกไซด์ ( $PbO$ ) ความบริสุทธิ์อย่างละ 99.9 บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศไทย เชื้อรา มัน
- 3.1.2 เชอร์โคเนียมไดออกไซด์ ( $ZrO_2$ ) ความบริสุทธิ์อย่างละ 99.0 บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศไทย เชื้อรา มัน
- 3.1.3 ไททาเนียมไดออกไซด์ ( $TiO_2$ ) ความบริสุทธิ์อย่างละ 99.0 บริษัท Riedel-de Haen ประเทศไทย เชื้อรา มัน
- 3.1.4 เชอร์โคเนียมไดออกไซด์ ( $ZrO_2$ ) nanopowder < 100 nm บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศไทย เชื้อรา เมริกา
- 3.1.5 แมกนีเซียมออกไซด์ ( $MgO$ ) nanopowder < 50 nm บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศไทย เชื้อรา เมริกา
- 3.1.6 ผงอะลูมิเนียมออกไซด์ ( $Al_2O_3$ ) ความบริสุทธิ์อย่างละ 99.0 บริษัท Fluka ประเทศไทย สถาบันเชอร์แลนด์
- 3.1.7 เอทิลแอลกอฮอลล์ (Ethyl alcohol) ความบริสุทธิ์อย่างละ 99.8 บริษัท Liquor Distillery Organization Excise Department ประเทศไทย
- 3.1.8 โพลีไวนิลแอลกอฮอลล์ (Polyvinyl alcohol: PVA) บริษัท Fluka ประเทศไทย เชื้อรา สถาบัน
- 3.1.9 กาวเงิน บริษัท SPI Supplies Division of STRUCTURE PROBE ประเทศไทย เชื้อรา เมริกา
- 3.1.10 อะซีติน
- 3.1.11 น้ำกลั่น
- 3.1.12 น้ำยาล้างจาน

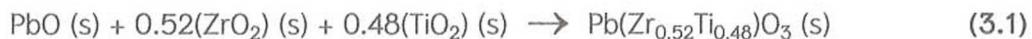
### 3.2 อุปกรณ์

- 3.2.1 เครื่องซึ่งติดต่อความละเอียด 0.0001 กรัม บริษัท Sartorius รุ่น MC1 Analytic AC210S ประเภทเยอรมัน
- 3.2.2 เครื่องซึ่งติดต่อความละเอียด 0.0001 กรัม บริษัท AND รุ่น HM-300 ประเภทญี่ปุ่น สำหรับซึ่งเพื่อคำนวณหาค่าความหนาแน่น
- 3.2.3 กระป๋องพลาสติกพร้อมฝาปิด
- 3.2.4 ลูกบดเซอร์โคเนียม ( $ZrO_2$ )
- 3.2.5 แท่งแม่เหล็กสำหรับกวนสาร (magnetic bar)
- 3.2.6 แท่นหมุนพร้อมมอเตอร์สำหรับหมุนกระป๋องเพื่อบดย่อยผสมสารแบบ ball-milling
- 3.2.7 บีกเกอร์ขนาด 250, 600 และ 1000 มิลลิลิตร
- 3.2.8 กระดาษฟอยล์ (foil)
- 3.2.9 กระดาษรองซึ่งสาร (weighing paper) บริษัท Whiteman
- 3.2.10 ตะแกรงร่อนสาร
- 3.2.11 ตีมจับชิ้นงาน
- 3.2.12 ครกบดสาร (agate)
- 3.2.13 ไตร์เป่าเพม สำหรับเป่าอุปกรณ์หรือชิ้นงานหลังทำการทดลอง
- 3.2.14 แปรงล้างขวด
- 3.2.15 ถ้วยอะลูมินา (alumina crucible)
- 3.2.16 เทปการคาร์บอน
- 3.2.17 เตาแห่นให้ความร้อนพร้อมเครื่องคนสารด้วยแม่เหล็ก (hot plate & magnetic stir) ยี่ห้อ Cimarec ปรับอุณหภูมิได้สูงสุด  $400^{\circ}\text{C}$  และปรับความเร็วในการคนสารด้วยแม่เหล็กได้ 12 ระดับ
- 3.2.18 ตู้อบสารปรับอุณหภูมิได้สูงสุดประมาณ  $200^{\circ}\text{C}$  บริษัท Griffin Grundy
- 3.2.19 เตาอบไฟฟ้า ยี่ห้อ Electrolux ประเภทไทย
- 3.2.20 เตาอบไฟฟ้า ยี่ห้อ HOUSE WORTH รุ่น HW-8085 ประเภทจีน
- 3.2.21 เตาไฟฟ้าสำหรับเผาสาร ยี่ห้อ Lenton Furnaces รุ่น 4279
- 3.2.22 แม่พิมพ์โลหะสำหรับอัดชิ้นรูปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร
- 3.2.23 เครื่องขัดระบบไฮดรอลิก ยี่ห้อ Carvert รุ่น C #3912
- 3.2.24 ติดต่อລາວອົບເນື່ອຄາລິເປົກ ยี่ห้อ ZIMM – ZEEM ประเภทจีน

- 3.2.25 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ YUGO รุ่น M920 ประเทศไทย
- 3.2.26 ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ ยี่ห้อ OAKTON ประเทศไทยจีน
- 3.2.27 เครื่องตรวจสอบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer) รุ่น X'Pert บริษัท Philips ประเทศไทยเนเธอร์แลนด์
- 3.2.28 เครื่อง Sputter Coater บริษัท The Polaron รุ่น SC7620 ประเทศไทยอังกฤษ
- 3.2.29 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) บริษัท LEO รุ่น 1455VP ประเทศไทยอังกฤษ
- 3.2.30 งานหมุนสำหรับขัดสาร ยี่ห้อ Struers รุ่น LaboPol -1 ประเทศไทยเดนมาร์ก
- 3.2.31 กระดาษทรายเบอร์ 400, 600, 800 และ 1000 ตราชานานงแอน
- 3.2.32 เครื่อง Precision LCR meter รุ่น E 4980 A, 20 Hz – 2 MHz บริษัท Agilent ประเทศไทยญี่ปุ่น
- 3.2.33 ผงขัดเพชรแบบสเปรย์ขนาดอนุภาค 1, 3 และ 6 μm บริษัท Kemet Internation ประเทศไทยอังกฤษ
- 3.2.34 กระดาษขัด DP-Dac, DP-Pan บริษัท Struers ประเทศไทยเนเธอร์แลนด์
- 3.2.35 กระดาษขัด Microcloth บริษัท Buehler ประเทศไทยสหรัฐอเมริกา
- 3.2.36 ผงขัดเพชร ขนาด 6, 3 และ 1 μm
- 3.2.37 เครื่อง UP2005 ultrasonic Processor บริษัท Hielscher Ultrasound Technology ประเทศไทยเยอรมัน
- 3.2.38 เครื่องวัดค่าความแข็งระดับจุลภาค (Microhardness tester) บริษัท Buehler รุ่น 1600–6100 ประเทศไทยสหรัฐอเมริกา
- 3.2.39 กล้องดิจิตอลต่อ กับเลนส์ตา (Digital Camera for Microscope) บริษัท I.P.O. Instrument Co. Ltd. รุ่น DCM 130 (USB 2.0) Resolution 1.3 Mpixels ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ โดยทาง USB ใช้กับโปรแกรม Scope Photo 3.0 Digital Camera for Microscope & Telescope
- 3.2.40 กล้องจุลทรรศน์แบบแสง บริษัท Wuzhou New Found Instrument รุ่น XJL-101 Reflected Light Metallurgical Microscope ประเทศไทยจีน
- 3.2.41 กล้องดิจิตอลต่อ กับเลนส์ตา (Digital Camera Eyepiece) บริษัท Pro-Way Optics & Electronics รุ่น DCE-PW1 ประเทศไทยเยอรมัน ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ USB PC Camera 301 P ใช้กับโปรแกรม T. DN-2 Microscopy Image Processing System
- 3.2.42 กล้องจุลทรรศน์ OPTIPHOT-2 ผลิตโดยบริษัท Nikon ประเทศไทยญี่ปุ่น

### 3.3 กระบวนการเตรียมผงผลึกเลดเชอร์โคเนตไททาเนต ( $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$ )

เตรียมผงเลดเชอร์โคเนตไททาเนตสูตร  $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$  ด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์ เริ่มจากการซึ่งสารตั้งต้น  $\text{PbO}$ ,  $\text{TiO}_2$  และ  $\text{ZrO}_2$  ตามสัดส่วนจำนวนโมล  $\text{Pb} : \text{Zr} : \text{Ti}$  เป็น  $1 : 0.52 : 0.48$  ด้วยการดุลสมการเดเมี๊ตามสมการ (3.1) จากนั้นซึ่งสารตามปริมาณที่คำนวณโดยใช้เครื่องซึ่งสารที่มีความละเอียด 0.0001 กรัม (รูป 3.1) สมการการดุลสมการเดเมี๊เป็นดังสมการข้างล่างนี้



นำสารตั้งต้นมาใส่ในกระป๋องพลาสติกที่บรรจุถุงดเชอร์โคเนียแล้วเติมเอทิลแอลกอฮอลล์ลงไปด้วยเพื่อเป็นตัวช่วยในการหล่อสินปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปวางบนแท่นหมุนพร้อมมอเตอร์สำหรับหมุนกระป๋องเพื่อบดย่อยผสมสารแบบ ball-milling ตามรูป 3.2 ทำการบดย่อยผสมการเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วกรองเอาของเหลวที่ผสมแล้วใส่บีกเกอร์ นำไปทำให้แห้งโดยใช้เตาแผ่นให้ความร้อนแบบมีเครื่องควบคุมด้วยแม่เหล็ก (รูป 3.3) ใช้ความร้อนประมาณ  $120-130^\circ\text{C}$  เมื่อของเหลวันั้นแห้งแล้ว นำไปอบอีกครั้งเพื่อให้แห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทำการร่อนผงผสมด้วยตะกรงร่อน นำผงที่ได้ใส่ถ้วยอะลูมินาปิดฝาแล้วนำไปเผาแคลไชน์ด้วยเตาไฟฟ้า (รูป 3.4) โดยแปรค่าอุณหภูมิในการเผาแคลไชน์ตั้งแต่ 500 ถึง  $900^\circ\text{C}$  เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง ด้วยอัตราการให้ความร้อน  $5^\circ\text{C}/\text{นาที}$  แผนภาพการเผาแคลไชน์แสดงดังรูป 3.5



รูป 3.1 เครื่องซึ่งสารความละเอียด 0.0001

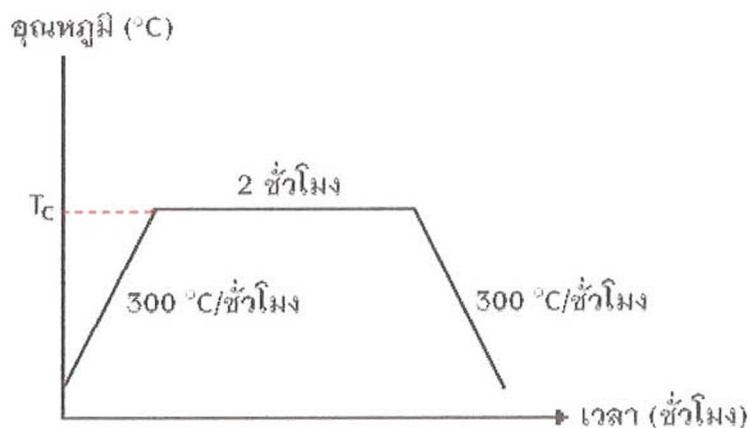


รูป 3.2 แท่นหมุนพร้อมมอเตอร์สำหรับหมุนกระป๋องเพื่อบดย่อยผสมสารแบบ Ball milling



รูป 3.3 เตาแฟนให้ความร้อนแบบมีเครื่อง  
ควบคุมด้วยแม่เหล็ก

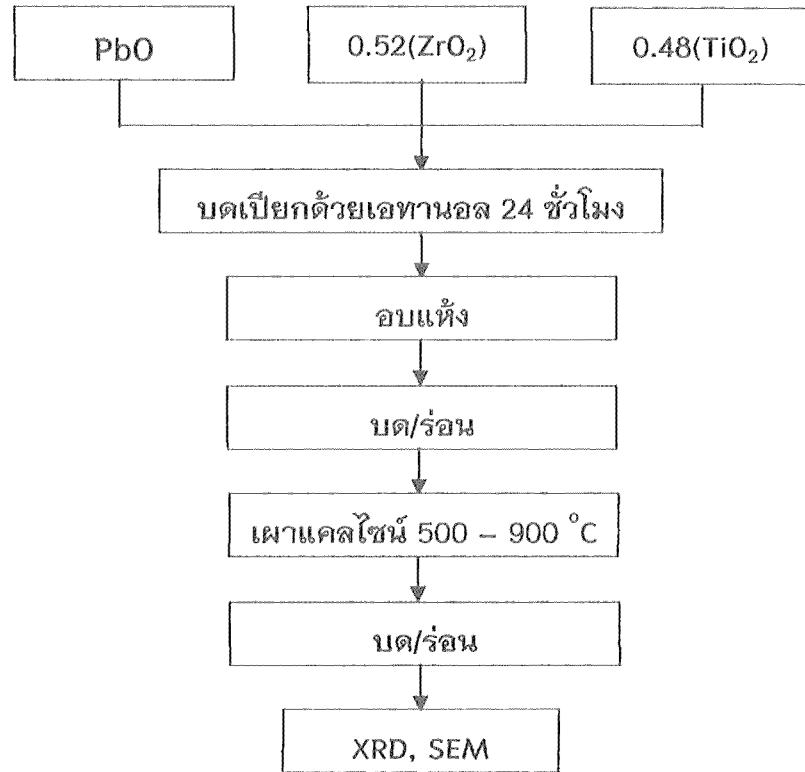
รูป 3.4 เตาไฟฟ้าสำหรับเผาแคลไซซ์และเผา  
ชิมเตอร์



รูป 3.5 แผนภาพการเผาแคลไซซ์ (โดย  $T_c$  คือ อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาแคลไซซ์)

นำผงพลีก  $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$  ที่เผาแคลไซซ์ที่อุณหภูมิต่างๆ ไปวิเคราะห์การก่อเกิดเฟส ที่เกิดขึ้นด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ และตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของผงพลีกที่ได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แผนผังแสดงขั้นตอนการเตรียมและ ตรวจสอบผงพลีก  $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$  แสดงดังแผนผังในรูป 3.6

### ขั้นตอนการเตรียมผงผลึก $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$



รูป 3.6 แผนผังการเตรียมผงผลึก  $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$

ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของผงผลึก  $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$  ทั้งหมดที่เตรียมได้จากการเผาแคลซิเซ่นด้วยเทคนิคการเลี้ยงเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) และคำนวณหาความบริสุทธิ์จากสมการที่ (3.2)

$$\text{ร้อยละความบริสุทธิ์ (\%)} = \frac{I_p}{(I_p + I_i)} \times 100 \quad (3.2)$$

โดยที่  $I_p$  แทนค่าความเข้มสูงสุดของพีดี X-ray ของเฟสหลัก  
 $I_i$  แทนค่าความเข้มสูงสุดของพีดี X-ray ของเฟสแบลกบลอม

### 3.4 กระบวนการเตريยมผงผลึก $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$ เมื่อเติมสารเจือที่มีอนุภาคระดับนาโนของ $MgO$ และ $ZrO_2$

นำผงผลึก  $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$  ที่เลือกคุณภาพที่เหมาะสมในการเผาแคลไซซ์น์ได้จากหัวข้อ 3.3 คือ  $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$  ที่เผาแคลไซซ์น์ที่คุณภาพ 800 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มาทำ การเติมสารเจือที่มีอนุภาคระดับนาโนของ  $MgO$  และ  $ZrO_2$  เป็นปริมาณร้อยละ 0.5, 1 และ 2 โดยปริมาตร โดยคำนวณให้เป็นปริมาณมวลของสารที่จะใช้ตามสมการที่ (3.3) และสมการ (3.4)

$$\% \text{Mass of additive(g)} = \left( \frac{\frac{\text{vol\%Additive}}{100} \times \rho_{\text{Additive}}}{\frac{\text{vol\%Additive}}{100} \times \rho_{\text{Additive}} + \left( 1 - \frac{\text{vol\%Additive}}{100} \right) \rho_{\text{Main}}} \right) \times 100 \quad (3.3)$$

เมื่อ  $\% \text{Mass of additive}$  เป็นร้อยละของมวลของสารเจือที่ต้องการแปลงจากร้อยละโดยปริมาตรที่ต้องการ  
 $\text{vol\%Additive}$  เป็นร้อยละโดยปริมาตรของสารเจือที่ต้องการแปลงค่า  
 $\rho_{\text{Main}}$  เป็นความหนาแน่นของสารที่เป็นเฟสหลัก ในงานวิจัยนี้ใช้  $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$   
 $\rho_{\text{Additive}}$  เป็นความหนาแน่นของสารเจือที่เป็นเฟสรอง ในงานวิจัยนี้ใช้ อนุภาคระดับนาโนของ  $MgO$  และ  $ZrO_2$

$$\% \text{Mass of main(g)} = 100 - \left[ \left( \frac{\frac{\text{vol\%Additive}}{100} \times \rho_{\text{Additive}}}{\frac{\text{vol\%Additive}}{100} \times \rho_{\text{Additive}} + \left( 1 - \frac{\text{vol\%Additive}}{100} \right) \rho_{\text{Main}}} \right) \times 100 \right] \quad (3.4)$$

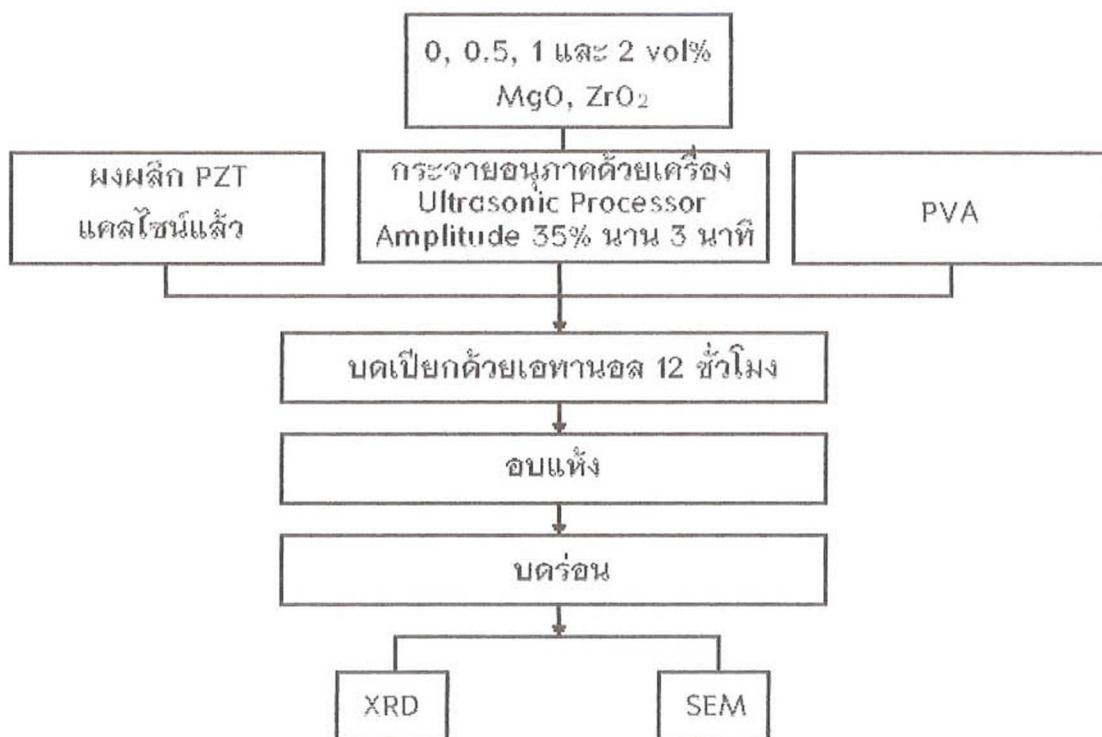
หรือ  $\% \text{Mass of main(g)} = 100 - \% \text{Mass of additive(g)}$

เมื่อ  $\% \text{Mass of main}$  เป็นร้อยละของมวลของสารที่เป็นเฟสหลัก

นำผงผลึก  $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$  ที่แคลไซซ์แล้ว สารเจือที่มีอนุภาคในระดับนาโนที่ทำการกรองอนุภาคด้วยเครื่อง Ultrasonic Processor ตั้งรูป 3.7 โดยใช้ Cycle 0.5 ใช้ Amplitude 35% นาน 3 นาที และ PVA ความเข้มข้น 3% โดยน้ำหนัก มาทำการบดผสมเปียกอีกครั้ง เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และทำแท่ง ตัดขนาดอีกครั้ง แผนผังการเตريยมผงผลึก  $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$  + สารเจือ แสดงตั้งรูป 3.8



รูป 3.7 เครื่อง Ultrasonic Processor ที่ใช้ในการกร磨อนุภาคของสารเจือ MgO และ ZrO<sub>2</sub>



รูป 3.8 แผนภาพขั้นตอนการเตรียมผงผลึก Pb(Zr<sub>0.52</sub>Ti<sub>0.48</sub>)O<sub>3</sub> ที่ผสมสารเจือระดับนาโนของ MgO และ ZrO<sub>2</sub>

จากนั้นนำผงผลึก Pb(Zr<sub>0.52</sub>Ti<sub>0.48</sub>)O<sub>3</sub> ที่ผสมสารเจือเรียบร้อยแล้วมาตรวจสอบโครงสร้างเฟสของผงผลึกอีกครั้งด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) และตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาของผงผลึก Pb(Zr<sub>0.52</sub>Ti<sub>0.48</sub>)O<sub>3</sub> ที่ผสมสารเจือเรียบร้อยแล้ว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

### 3.5 กระบวนการเตรียมเซรามิก $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$ เมื่อเติมอนุภาคระดับนาโนของ $MgO$ และ $ZrO_2$

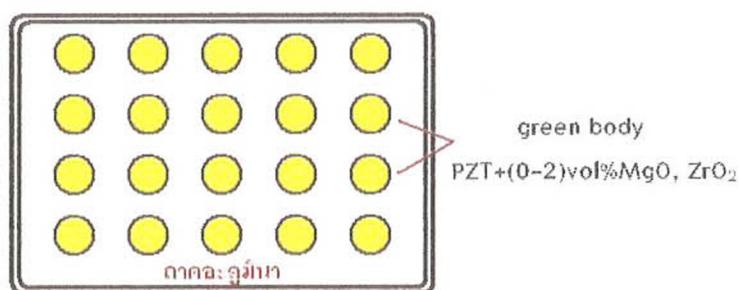
นำผงลีก  $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$  ที่เติมสารเจือที่มีอนุภาคระดับนาโนของ  $MgO$  และ  $ZrO_2$  ในปริมาณร้อยละ 0–2 โดยปริมาตร มาอัดขึ้นรูปครึ่ง ละ 1 กรัม ซึ่งชิ้นงานที่ได้จะมีลักษณะเป็นแผ่นกลม (Disk) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร โดยทำการอัดในแม่พิมพ์โลหะ ตั้งรูป 3.9 ด้วยเครื่องอัดระบบไฮดรอลิก (รูป 3.10) ด้วยความดัน 0.6 ตัน เป็นเวลานาน 25–30 วินาที เมื่อได้ชิ้นงานที่ผ่านการอัดขึ้นรูป (green body) และวิ่งนำมาจัดเรียงในถาดอะลูมินา ตั้งรูป 3.11 นำไปเผากำจัดตัวประสานออกที่อุณหภูมิ  $550\text{ }^{\circ}\text{C}$  โดยให้อัตราความร้อนอย่างช้าๆ  $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{นาที}$  ตั้งแพนภาพในรูป 3.12



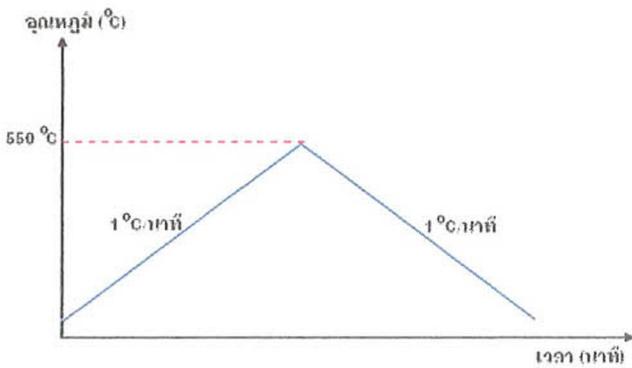
รูป 3.9 แม่พิมพ์โลหะ



รูป 3.10 เครื่องอัดระบบไฮดรอลิก

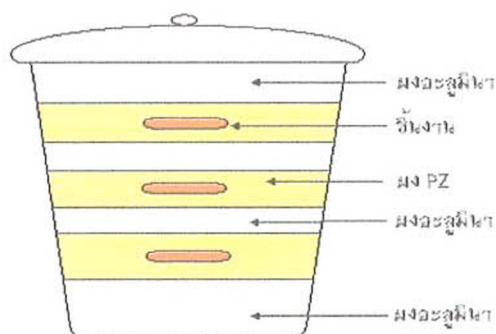


รูป 3.11 การจัดเรียงชิ้นงานบนถาดอะลูมินา

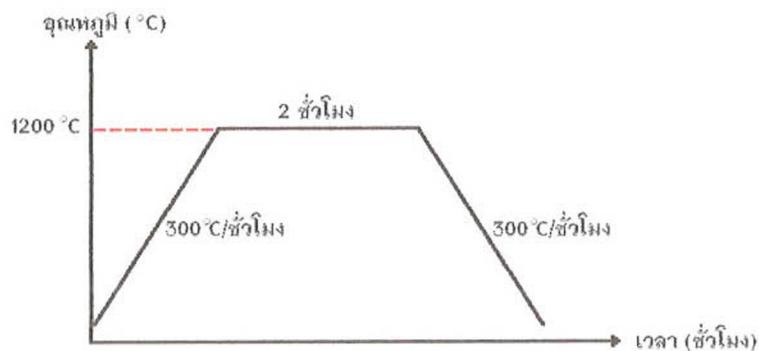


รูป 3.12 แผนผังการเผาเพื่อกำจัด PVA

หลังจากทำการกำจัด PVA และ นำเม็ดชิ้นงานมาเรียงลงในถ้วยอะลูมินาที่รองกันและกลบด้วยผงอะลูมินาโดยทำการกลบชิ้นงานด้วยผงสัก  $PbZrO_3$  ดังรูป 3.13 เพื่อป้องกันการระเหยของตะกั่วออกจากชิ้นงานในระหว่างที่ทำการเผาซินเตอร์ ซึ่งเป็นการทำให้การเผาซินเตอร์อยู่ในบรรยากาศของตะกั่วนั่นเอง จากนั้นปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปเผาซินเตอร์โดยใช้เตาไฟฟ้า (รูป 3.4) ณ อุณหภูมิ  $1200\text{ }^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยมีอัตราการให้ความร้อน  $5\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{นาที}$  แผนภาพการเผาซินเตอร์เป็นดังรูป 3.14 เมื่อเผาซินเตอร์แล้วนำเซรามิกที่ได้ไปล้างและทำความสะอาดชิ้นงานอีกครั้งด้วยเครื่องอัลตราโซนิก ดังรูป 3.15 นำเซรามิกที่ล้างทำความสะอาดแล้วอบด้วยเตาอบไฟฟ้าดังรูป 3.16 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ขั้นตอนการเตรียมและตรวจสอบสมบัติของเซรามิก  $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3 + (0-2)\text{ vol\% MgO, ZrO}_2$  แสดงดังแผนผังในรูป 3.17



รูป 3.13 การจัดเรียงชิ้นงานในถ้วยอะลูมินาสำหรับการเผาซินเตอร์



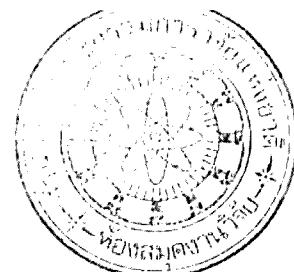
รูป 3.14 แผนภาพการเผาชิ้นเตอร์



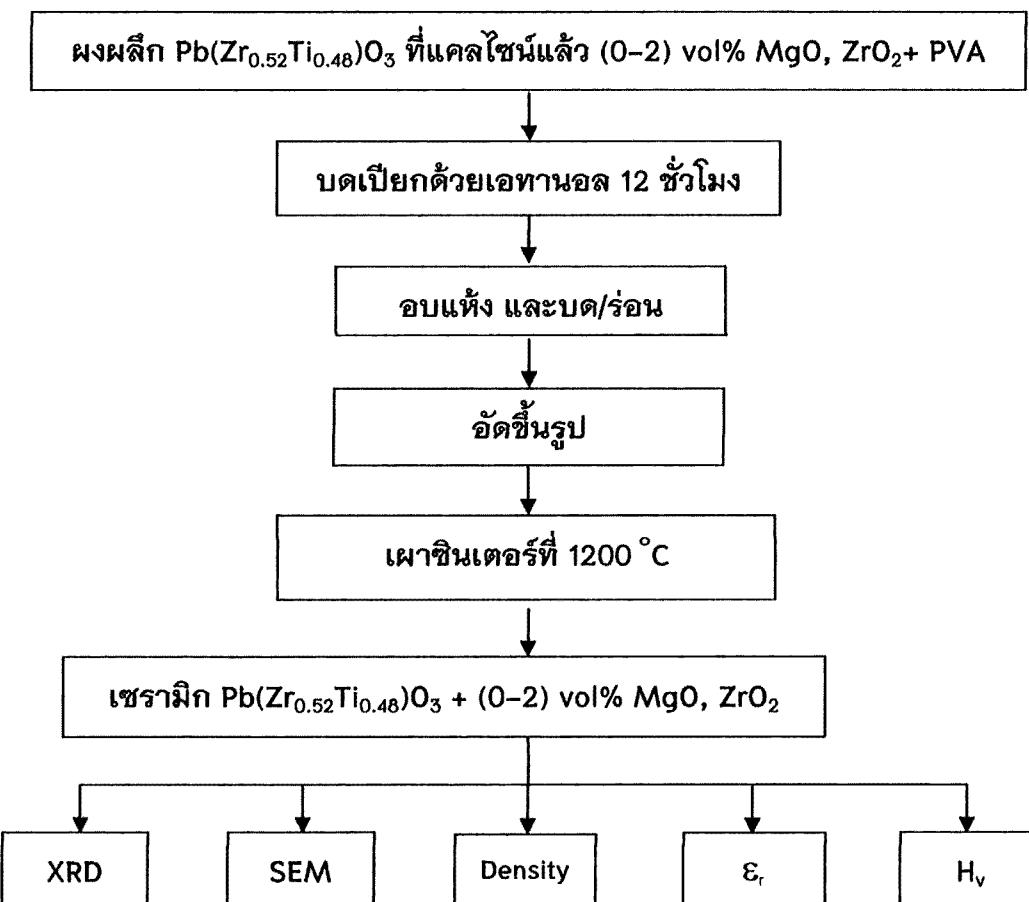
รูป 3.15 เครื่องอัลตราโซนิก



รูป 3.16 เตาอบไฟฟ้า

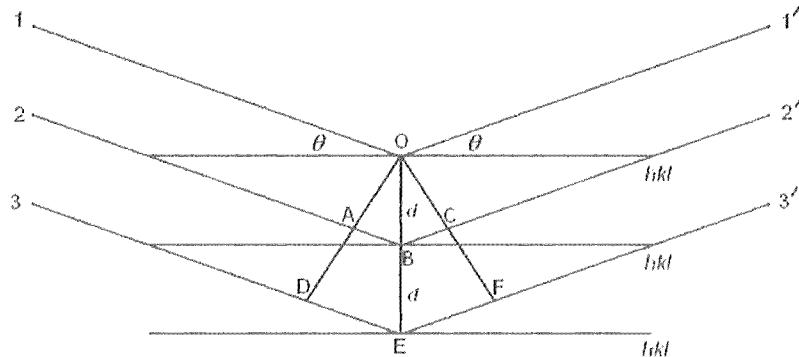


ขั้นตอนการเตรียมและตรวจสอบสมบัติของเซรามิก  $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3 + (0-2) \text{ vol\% MgO, ZrO}_2$  nanoparticles



รูป 3.17 แผนผังการเตรียมและตรวจสอบสมบัติของเซรามิก  $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$  ที่มีสารเจืออนุภาคระดับนาโนของ  $\text{MgO}$  และ  $\text{ZrO}_2$

### 3.6 การตรวจสอบเฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์



รูป 3.18 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์จากระนาบของอะตอม [29]

ผลึกที่มีการวางแผนเรียงตัวของอะตอมอย่างเป็นระเบียบเป็นชั้นๆ บนชุดระนาบ ( $hkl$ ) ดังรูป 3.18 เมื่อเกิดการกระเจิงของรังสีเอกซ์จากชั้นอะตอมเหล่านี้ ณ มุม  $\theta$  ถ้าค่าสี่เหลี่ยมที่เลี้ยวเบนออกมานี้มีเพสเดียวกัน จะเกิดการรวมกันแบบเสริมกันได้นั่นจะต้องมีระยะทางเดินของคลื่นต่างกันอยู่เป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่น ซึ่งสามารถเขียนได้ดังสมการ (3.5) โดยเรียกสมการนี้ว่ากฎของแบรกค์ (Bragg's law)

$$2d \sin \theta = n\lambda \quad (3.5)$$

เมื่อ  $d$  เป็นระยะห่างระหว่างระนาบของผลึก ( $h k l$ )

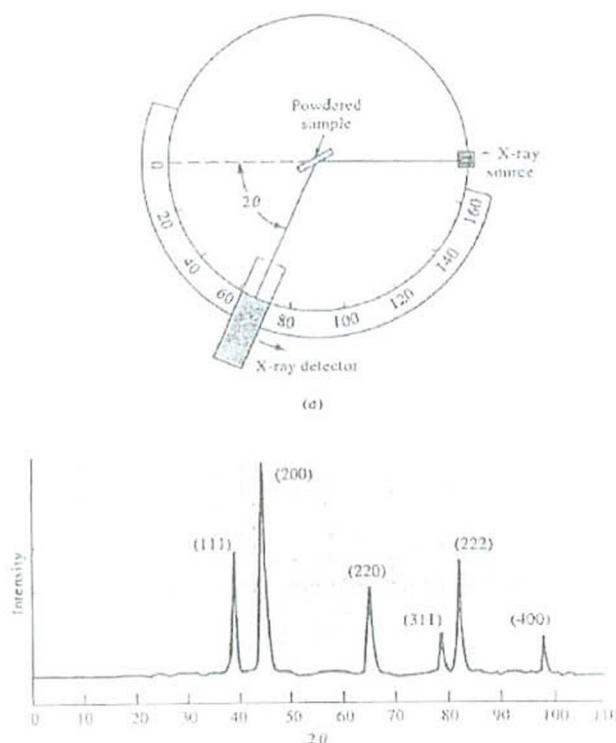
$\theta$  เป็นมุมระหว่างรังสีต่อกลไกทบทับกับระนาบของผลึก

$n$  เป็นเลขจำนวนเต็มใดๆ  $= 1, 2, 3, \dots$

$\lambda$  เป็นความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์

ผลึกแต่ละชนิดจะมีขนาดและการจัดเรียงตัวของอะตอมภายในที่แตกต่างกัน เมื่อนำมาตรวจสอบด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ จะได้รูปแบบการเลี้ยวเบนที่แตกต่างกัน โดยที่รูปแบบของการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของวัสดุแต่ละชนิดนั้นเกิดขึ้นตามลักษณะของวัสดุนั้นๆ ดังนั้นเมื่อนำเครื่องมือสำหรับตรวจวัด (detector) มารองรับรังสีเอกซ์ที่กระเจิงออกมาจากวัสดุในตำแหน่งต่างๆ ก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าวัสดุนั้นเป็นวัสดุหรือสารชนิดใด โดยพิจารณาจากข้อมูลของความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุมของแบรกค์ (Bragg's angle) และความเข้มของพิรังสีเอกซ์ของรูปแบบการเลี้ยวเบนที่ปรากฏ (รูป 3.19) ซึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสารแต่ละชนิดจะมีรูปแบบของการเลี้ยวเบนที่เป็นลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป จึงสามารถนำรูปแบบ

ของการเลี้ยงเบนของรังสีเอกซ์ที่ตรวจสอบได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลของสารชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐาน (JCPDS files) เพื่อตรวจสอบชนิดของเฟลที่เกิดขึ้นได้ โดยเริ่มจากการนำผงและชิ้นงานเซรามิกที่เตรียมได้มาแพคใส่ใน holder จากนั้นนำไปวางที่บริเวณช่องสำหรับวางชิ้นงานในเครื่อง X-ray diffractometer (รูป 3.20) และจึงเดินเครื่องโดยใช้เป้าห้องแดง ( $CuK_{\alpha}$ ) ที่ให้รังสีเอกซ์ค่าความยาวคลื่นประมาณ  $1.540562 \text{ \AA}$  ออกมาด้วย step ประมาณ 0.01 องศาต่อวินาที จากค่ามุม 20 ที่ 10 องศา ไปจนถึงที่ค่ามุม 20 ที่ 60 องศา



รูป 3.19 หลักการตรวจสอบเฟลด้วยเทคนิค XRD และตัวอย่างรูปแบบการเลี้ยงเบนของรังสีเอกซ์



รูป 3.20 เครื่อง X-ray diffractometer รุ่น X'Pert บริษัท Philips ประเทศไทยเนเธอร์แลนด์

**3.7 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของผงผลึก  $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$ , ผงผลึก  $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$  ที่เติมสารเจือระดับนาโนของ  $MgO$ ,  $ZrO_2$  และเซรามิก  $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$  ที่เติมสารเจือระดับนาโนของ  $MgO$ ,  $ZrO_2$**

**ผงผลึก**

นำผงผลึก  $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$  ที่ยังไม่เผาแคลโลไซน์ และที่เผาแคลโลไซน์ที่อุณหภูมิ  $500 - 900^{\circ}\text{C}$  มาทำการตรวจสอบลักษณะของโครงสร้างจุลภาค เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบในการอธิบายลักษณะรูปร่างและการเกาะตัวของผงเซรามิก โดยนำผงเซรามิกที่ต้องการตรวจสอบมาเรียบฐานวางสาร (sample holder) ที่ติดด้วยเทปภาวดาร์บอน (carbon tape) แล้วทำการเคลือบผิวของชิ้นงานด้วยทองคำโดยใช้เทคนิค sputtering ด้วยเครื่อง Sputter Coater ดังรูป 3.21 จากนั้นจึงนำไปทำการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ดังรูป 3.22

ทำเช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนเป็นผงผลึก  $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$  ที่เติมสารเจือ  $MgO$  และ  $ZrO_2$  ที่มีอุณหภูมิระดับ nano

**เม็ดเซรามิก**

นำชิ้นงานเซรามิก  $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$  ที่เติมสารเจือระดับนาโนของ  $MgO$  และ  $ZrO_2$  ที่เผาชิ้นเตอร์ ณ อุณหภูมิ  $1200^{\circ}\text{C}$  มาทำการทดสอบด้วยเครื่องอัลตราโซนิก เป็นเวลานาน 15-30 นาที เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออกไปจากผิวหน้าชิ้นงาน จากนั้นนำไปอบให้แห้ง แล้วจึงหักชิ้นงานออกเป็นชิ้นเล็กๆ นำแต่ละชิ้นไปติดบนฐานวางสารตัวอย่าง ที่ติดด้วยเทปภาวดาร์บอน เช่นกัน โดยจัดให้ผิวหน้า (surface) ทางตัวอยู่ในแนวที่เหมาะสมต่อการสำรวจด้วยเทคนิค SEM แล้วทำการเคลือบผิวของชิ้นงานด้วยทองคำโดยใช้เทคนิค sputtering จากนั้นจึงนำไปทำการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างจุลภาค ของชิ้นงานต่อไป



รูป 3.21 เครื่อง Sputter coater รุ่น SC7620



รูป 3.22 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด บริษัท LEO รุ่น 1455VP

### 3.8 การตรวจสอบค่าความหนาแน่น (Density) และความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative density)

#### การหาความหนาแน่น (Density)

การหาค่าความหนาแน่นของเซรามิกที่เตรียมได้โดยอาศัยหลักการแทนที่น้ำของอาร์คีเมดีส (Archimedes) [30] เริ่มจากนำเซรามิกที่ต้องการทราบค่ามาต้มในน้ำกลั่นเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นในอากาศ และทิ้งให้อิ่มตัวด้วยน้ำเป็นเวลา 1 คืนจากนั้นจึงนำมาซึ่งในน้ำ ( $W_3$ ) ซึ่งขณะเปียก ( $W_2$ ) และนำไป秤ในเตาอบไฟฟ้าเป็นเวลา 1 คืน เพื่อนำมาซึ่งมวลขณะแห้ง ( $W_1$ ) โดยใช้เครื่องซึ่งดิจิตอลความละเอียด 0.0001 กรัม (รูป 3.23) และจึงนำค่าที่ได้มาคำนวณหาความหนาแน่น ดังสมการ (3.6)

$$\rho_c = \left( \frac{W_1}{W_2 - W_3} \right) \times \rho_{H_2O} \quad (3.6)$$

เมื่อ  $\rho_c$  คือ ความหนาแน่นของเซรามิก

$\rho_{H_2O}$  คือ ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิขณะทำการทดลอง

$W_1$  คือ น้ำหนักของเซรามิกที่ซึ่งในอากาศขณะแห้ง (มวลแห้ง)

- $W_2$  คือ น้ำหนักของเซรามิกที่ซึ่งในขณะเปียก (มวลมาก)
- $W_3$  คือ น้ำหนักของเซรามิกที่ซึ่งในขณะอุ่นในน้ำ (มวลเปียก)



รูป 3.23 เครื่องซึ่งดิจิตอลความละเอียด 0.0001 กรัม สำหรับหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน

#### การหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ (*Relative density*)

เมื่อได้ความหนาแน่นเชิงทฤษฎีของเซรามิกที่ผสานของสารเจือที่มีอนุภาคระดับนาโนในปริมาณต่างๆ กันแล้ว จึงนำมาคำนวณหาความหนาแน่นสัมพัทธ์เพื่อใช้เปรียบเทียบค่าความหนาแน่นของชิ้นงานที่มีสารเจือปนได้โดยใช้สมการ (3.7)

$$\text{ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (\%)} = \left( \frac{\rho_{th} - \rho_s}{\rho_{th}} \right) \times 100 \quad (3.7)$$

เมื่อ  $\rho_{th}$  และ  $\rho_s$  คือความหนาแน่นเชิงทฤษฎีและความหนาแน่นของเซรามิกที่ได้จากการทดลองตามลำดับ

### 3.9 การศึกษาค่าร้อยละการหดตัวหลังการเผา (Percent shrinkage)

นำเซรามิกที่ได้มาตรวจสอบหาค่าร้อยละการหดตัวของเซรามิกภายหลังการเผาชิ้นเดอร์ในรูปของการหดตัวเชิงเส้น (Linear shrinkage) ด้วยการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานก่อนและหลังการเผาชิ้นเดอร์ จากนั้นจึงคำนวณที่ได้มาคำนวนหาวิธีการหดตัวของเซรามิกดังสมการ (3.8) ดังนี้

$$\text{การหดตัวเชิงเส้น (\%)} = \left( \frac{d_1 - d_2}{d_1} \right) \times 100 \quad (3.8)$$

เมื่อ  $d_1$  และ  $d_2$  เป็น เส้นผ่านศูนย์กลางของเซรามิกก่อนและหลังการเผาชิ้นเดอร์ ตามลำดับ

### 3.10 การศึกษาค่าคงที่ไดอิเล็กทริก และการสูญเสียเนื่องจากความร้อนทางไดอิเล็กทริก

ทำการเตรียมชิ้นงานเซรามิก  $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$  ที่เติมสารเจือระดับนาโนของ  $MgO$  และ  $ZrO_2$  สำหรับการทดสอบวัดหาค่าคงที่ไดอิเล็กทริก และการสูญเสียเนื่องจากความร้อนทางไดอิเล็กทริก โดยการขัดผิวหน้าของชิ้นงานเซรามิกด้วยกระดาษทรายเบอร์ 200, 400, 600, 800 และ 1000 ตามลำดับ โดยใช้จานหมุนสำหรับขัดสาร (รูป 3.24) เพื่อให้ผิวทั้งสองด้านของเซรามิกอยู่ในแนวระนาบและเรียบสม่ำเสมอ นำชิ้นงานไปล้างทำความสะอาดผิวด้วยน้ำที่มีส่วนผสมน้ำยาล้างจานเพียงเล็กน้อยเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่หลุดออกมานอกเหนือจากชิ้นงานที่ทำการขัดผิวหน้าของเซรามิก จากนั้นนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิประมาณ  $120^{\circ}\text{C}$  โดยใช้เตาอบ นำมาวัดขนาดความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานก่อนการทำหัวด้วยเวอร์เนียคลิปอร์แบบดิจิตอล (รูป 3.25) ทำการทำกาเงินเพื่อทำหัวโดยทากาเงินที่ลําด้านของชิ้นงานแล้วนำชิ้นงานไปอบเพื่อให้กาเงินแห้งจนครบทั้งสองด้าน เมื่อชิ้นงานแห้งนำไปทำความสะอาดด้วยน้ำซึ่งมีอุณหภูมิ  $550^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 15 นาที ใช้อัตราการขึ้น/ลง อุณหภูมิเป็น  $5^{\circ}\text{C}/\text{นาที}$  ตรวจสอบหัวที่ทำได้ว่าติดกันตลอดทั้งหน้าของชิ้นงานหรือไม่ด้วยโอลิฟินมิเตอร์ ระหว่างอย่าให้หัวสองด้านของผิวน้ำซึ่งติดกัน นำชิ้นงานที่ได้มาทำการวัดค่าความจุไฟฟ้า ( $C$ ) และค่าการสูญเสียเนื่องจากความร้อนทางไดอิเล็กทริก ( $tan \delta$ ) โดยใช้เครื่อง LCZ meter ดังรูป 3.26 วัดที่ความถี่ 1, 10, 100, 500 kHz และ 1 MHz ซึ่งค่าความจุที่วัดได้นั้นสามารถนำมาคำนวนหาค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ค่าสภาพ ยอดรวมสัมพัทธ์) ได้จากการสมการ (3.9)

$$\epsilon_r = \frac{tC}{\epsilon_0 A} \quad (3.9)$$

เมื่อ  $\epsilon_r$  คือ ค่าคงที่โดยเล็กทริก หรือค่าสภาพย้อมสัมพัทธ์ของชิ้นงาน  
 $\epsilon_0$  คือ ค่าสภาพย้อมของสุญญากาศมีค่าประมาณ  $8.854 \times 10^{-15}$  F/mm<sup>-2</sup>  
 $C$  คือ ค่าความจุไฟฟ้า  
 $t$  คือ ความหนาของชิ้นงาน  
 $A$  คือ พื้นที่หน้าตัดของชิ้นงาน



รูป 3.24 งานหมุนสำหรับขัดสารตัวอย่าง



รูป 3.25 ดิจิตอลแคลร์เนียคลิปครัว



รูป 3.26 LCR meter รุ่น E 4980 A 20Hz-2 MHz

### 3.11 การหาค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers hardness)

ทำการเตรียมชิ้นงานนำเซรามิก  $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$  ที่เติมสารเจือระดับนาโนของ  $\text{MgO}$  และ  $\text{ZrO}_2$  เผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ  $1200^{\circ}\text{C}$  มาทำการขัดเพื่อให้ได้ระนาบ และทำการขัดให้เงา เป็นกระจก โดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 400, 600, 800, 1000 และใช้สเปรย์พงขัดเพชรขนาดอนุภาค 6, 3 และ 1  $\mu\text{m}$  พ่นบนกระดาษขัด DP-Dac, DP-Pan, Microcloth เพื่อขัดเงาเม็ดเซรามิก โดยใช้จานหมุนสำหรับขัดสาร ดังรูป 3.23 ช่วยในการขัดผิวน้ำของชิ้นงาน เมื่อผิวน้ำเงา เป็นกระจกแล้ว นำชิ้นงานมาล้างทำความสะอาด อบให้แห้ง และนำไปทดสอบค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ ดังรูป 3.27 โดยการกดด้วยโหลดขนาด 300 และ 500 กรัม เป็นเวลา 15 วินาที ตัวอย่างละ 6 จุด และคำนวณค่าเฉลี่ย



รูป 3.27 เครื่องวัดค่าความแข็งระดับจุลภาค (Microhardness tester)

การหาค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (3.10) [31]

$$H_V = 1854.4 \left( \frac{P}{d^2} \right) \quad (3.10)$$

เมื่อ  $H_V$  คือค่าความแข็งในหน่วยของวิกเกอร์ (GPa)

$P$  คือโหลดที่ใช้แก่หัวกด (N)

$d$  คือค่าความยาวเฉลี่ยของเส้นที่แยกมุมของรอยกด ( $\mu\text{m}$ )